

Электронно-лучевая литография на оборудовании Raith GmbH: от идеи до реализации

Научно-практический семинар
28 мая 2012 года

Программа семинара

Время	Доклад	Докладчик
11.00-11.10	Вступительное слово	Мальцев Петр Павлович д.т.н., профессор, директор ИСВЧПЭ РАН, Москва
11.10-11.20	Welcome and “About Raith company”	Dirk Brueggemann Director Sales New Markets, Raith GmbH, Germany
11.20-11.30	ОПТЭК представляет высокотехнологичные решения для науки	Власенко Вячеслав Сергеевич Руководитель направления материаловедения, ООО «ОПТЭК», Москва
11.30-12.15	Raith product portfolio and applications	Martin Kirchner Director Sales New Markets, Raith GmbH, Germany
12.15-12.30	Coffee break	
12.30-13.00	Основные достижения Учреждения Российской академии наук Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники РАН (ИСВЧПЭ РАН) в области создания монокристаллических интегральных схем СВЧ диапазона	Федоров Юрий Владимирович Зав.Лаб. ИСВЧПЭ РАН, Москва
13.00-13.30	Resistless Lithography with Raith ionLiNE. Instrument concept and applications	Sven Bauerdick Product Manager, Raith GmbH, Germany
13.30-14.00	Разработка технологии изготовления матрицы линз Френеля с помощью Raith QUANTUM	Гончаров Антон Сергеевич инженер НИИ РЛ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва
14.00-14.20	Методы экспонирования без стыковки полей	Литвин Леонид Владимирович application scientist, Raith GmbH, Germany
14.20 -15.30	Обед	

Экскурсия для ознакомления с работой электронно-лучевого литографа Raith 150TWO

Дата	Время	Группа
29 мая	11.00-12.00	Группа 1
30 мая	11.00-12.00	Группа 2
31 мая	11.00-12.00	Группа 3
1 июня	11.00-12.00	Группа 4
2 июня	11.00-12.00	Группа 5

С 29 мая по 2 июня у Вас есть возможность посетить лабораторию ИСВЧПЭ РАН, подав заявку в день проведения семинара (28 мая) на стойке регистрации.